



Material Characterization

CMP (Chemical Mechanical Planarization)

Particle Size

粒子径

レーザー回折 / 散乱式粒子径分布測定装置

Partica LA-960V2

- ワイドレンジ
- 高精度保証
- 高濃度測定可能



[分析・計測技術]

- ▶ レーザー回折/散乱
- ▶ 動的光散乱
- ▶ ドップラー効果
- ▶ 遠心分離
- ▶ 吸光度
- ▶ 電気化学
- ▶ 流量制御

Chemical Concentration Monitor

洗浄液(過水)濃度

非接触型薬液濃度モニター

CS-900

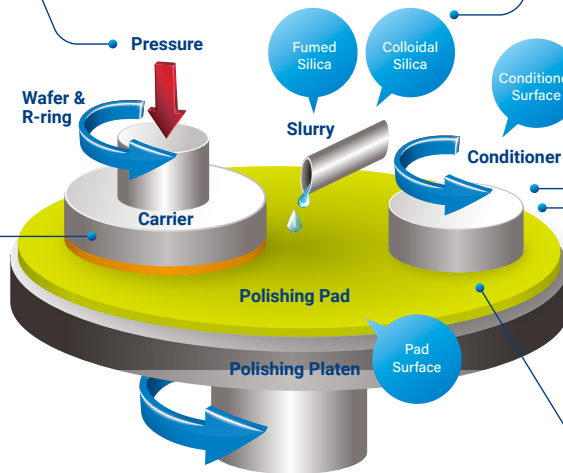
- コンタミレス
- 簡単取り付け
- コンパクト



遠心式ナノ粒子解析装置

Partica CENTRIFUGE

- 原液～希薄試料まで測定可能
- 少量異物・凝集観察
- 長時間安定測定



IPA Concentration

IPA濃度

パブリック供給ライン用インラインガス濃度モニター

IR-300

- リアルタイムモニタリング
- 複数検量線機能
- 濃度、圧力、温度をモニター



pH Measurement

pH評価

微量サンプリングpHモニター

UP-100 Series

- 微量サンプリング
- リアルタイム測定
- メンテナンス周期大幅低減



Zeta Potential

ゼータ電位

ナノ粒子解析装置

nanoPartica SZ-100V2

- 粒子径・ゼータ電位・分子量測定
- 粒子径0.3nmから対応
- 希薄試料から高濃度試料まで測定可能



Film Quality

研磨後膜質評価

分光エリフソメーター

UVISEL Plus

- 超薄膜の膜厚・屈折率・消衰係数を分析
- 膜質の均一性を評価

